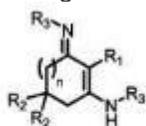


PATENTE DE INVENCION

COMPUESTOS FOTOPROTECTORES ANÁLOGOS DE MAA, PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS Y COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LOS MISMOS

Resumen

La invención describe nuevos compuestos fotoprotectores análogos de MAA que presentan de manera general la fórmula 1:



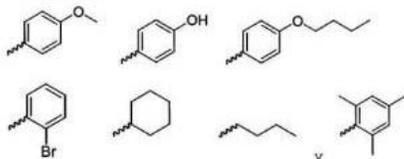
Fórmula 1

y sus sales y solvatos aceptables; en la que:

R₁ se selecciona del grupo constituido por alquilo C₁₋₆, S-alquilo C₁₋₆ y O-alquilo C₁₋₆;

R₂ se seleccionan cada uno del grupo constituido por H y alquilo C₁₋₆;

R₃ se seleccionan cada uno del grupo constituido por



Y n es un número entero seleccionado del grupo constituido por 0, 1 y 2.

La invención también describe procedimientos de síntesis de tales compuestos así como composiciones que los comprenden.

[Enlace a la patente](#)

Ventaja técnica:

Nuevos compuestos fotoprotectores análogos de MAA que presenten una fotoestabilidad aumentada con respecto a los compuestos de MAA naturales conocidos, y que además puedan obtenerse por vía sintética con rendimientos aceptables desde el punto de vista de la aplicación industrial.

Da a conocer una composición de protección frente a radiaciones solares

Inventores: Sampedro Ruiz, Diego; Losantos Cabello, Raúl; Funes Ardoiz, Ignacio

Departamento: Química **Área:** Química Orgánica

Titular: Universidad de La Rioja.

Sector técnico: Protección frente a radiaciones solares, filtro UV para cosméticos, aditivo de polímeros, resinas y pinturas.



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**



**FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros en:

OTRI, Universidad de La Rioja
Avda. de la Paz, 107
26006, Logroño
Tfno. 941 299 557
Fax. 941 299 183
otri@unirioja.es
www.unirioja.es/otri